装置番号	装置名	設置場所	分類
COL001	ゲート金属スパッタ成膜装置（スパッタ装置Ａ室）	4Fクリーンルーム	成膜装置
COL002	配線金属スパッタ成膜装置（スパッタ装置Ｂ室）	4Fクリーンルーム	成膜装置
COL003	プラズマポリシリコン成膜装置	4Fクリーンルーム	成膜装置
COL004	プラズマ絶縁膜成膜装置	4Fクリーンルーム	成膜装置
COL005	半導体酸化膜エッチング装置	4Fクリーンルーム	エッチング装置
COL006	金属エッチング装置	4Fクリーンルーム	エッチング装置
COL007	アッシング装置（MAS装置A室）	4Fクリーンルーム	エッチング装置
COL008	等方性エッチング装置（MAS装置B室）	4Fクリーンルーム	エッチング装置
COL009	原子層堆積装置(ALD)	4Fクリーンルーム	成膜装置
COL010	自動洗浄装置	4Fクリーンルーム	ウェット処理装置
COL011	酸化炉（横型三段炉上段）	4Fクリーンルーム	熱処理装置
COL012	加熱炉（横型三段炉中段）	4Fクリーンルーム	熱処理装置
COL013	水素シンター炉（横型三段炉下段）	4Fクリーンルーム	熱処理装置
COL014	熱ポリシリコン成膜装置	4Fクリーンルーム	成膜装置
COL015	熱窒化膜成膜装置	4Fクリーンルーム	成膜装置
COL016	急速加熱装置(RTA)	4Fクリーンルーム	熱処理装置
COL017	電子線描画装置	4Fクリーンルーム	リソグラフィ装置
COL018	レジスト塗布・現像装置	4Fクリーンルーム	ウェット処理装置
COL019	マスクレス露光装置	4Fクリーンルーム	リソグラフィ装置
COL020	エピタキシャル成長装置	3Fクリーンブース	結晶成長装置